

特許協力条約

PCT

REC'D 17 NOV 2005

WIPO

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

(法第 12 条、法施行規則第 56 条)
〔PCT 36 条及び PCT 規則 70〕

出願人又は代理人 の書類記号 TU04-0705W01	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/010361	国際出願日 (日.月.年) 14.07.2004	優先日 (日.月.年) 05.08.2003
国際特許分類(IPC) Int.Cl. C23C14/34, C22C5/00, 9/00, 16/00, 19/07, 45/02, 45/10		
出願人(氏名又は名称) 株式会社 日鉱マテリアルズ		

1. この報告書は、PCT第35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第57条（PCT第36条）の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a. 附属書類は全部で 2 ページである。

補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙（PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照）

□ 第Ⅰ欄4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとの
国際予備審査機関が認定した差替え用紙

- b. 電子媒体は全部で _____ (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。
(実施細則第802号参照)

- #### 4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- 第Ⅰ欄 國際予備審査報告の基礎

第Ⅱ欄 優先権

第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての國際予備審査報告の不作成

第Ⅳ欄 発明の單一性の欠如

第Ⅴ欄 P C T35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

第VI欄 ある種の引用文献

第VII欄 國際出願の不備

第VIII欄 國際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 12.01.2005	国際予備審査報告を作成した日 07.11.2005
名称及びあて先 日本国特許庁 (I P E A / J P) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目 4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 田中 則充 電話番号 03-3581-1101 内線 3416 4G 9730

第I欄 報告の基礎

1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。

- 出願時の言語による国際出願
- 出願時の言語から次の目的のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
- 国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))
- 国際公開 (PCT規則12.4(a))
- 国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT第14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

- 出願時の国際出願書類

- 明細書

第 1-13 ページ、出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

- 請求の範囲

第 _____ 項、出願時に提出されたもの
 第 _____ 項*、PCT第19条の規定に基づき補正されたもの
 第 2, 3, 7-13 項*、12.01.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ 項*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

- 図面

第 1-8 ページ/図*、出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ/図*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ/図*、_____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

- 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. 補正により、下記の書類が削除された。

<input type="checkbox"/> 明細書	第 _____	ページ
<input checked="" type="checkbox"/> 請求の範囲	第 1, 4-6	項
<input type="checkbox"/> 図面	第 _____	ページ/図
<input type="checkbox"/> 配列表 (具体的に記載すること)	_____	
<input type="checkbox"/> 配列表に関するテーブル (具体的に記載すること)	_____	

4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかつたものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

<input type="checkbox"/> 明細書	第 _____	ページ
<input type="checkbox"/> 請求の範囲	第 _____	項
<input type="checkbox"/> 図面	第 _____	ページ/図
<input type="checkbox"/> 配列表 (具体的に記載すること)	_____	
<input type="checkbox"/> 配列表に関するテーブル (具体的に記載すること)	_____	

* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 2, 3, 7-13	有
	請求の範囲 _____	無
進歩性 (I S)	請求の範囲 2, 3, 7-13	有
	請求の範囲 _____	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 2, 3, 7-13	有
	請求の範囲 _____	無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

平均結晶子サイズが 1 nm～5 nm の組織を備え、Zr, Pt, Pd, Fe, Co, Cu から選択した少なくとも 1 元素を主成分として原子比率で 50 at% 以上含有する 3 元系以上合金からなり、1.2% 以上の原子半径差及び負の混合熱を満たす金属ガラスの要件を備え、96.4% 以上の相対密度を有し、ガスマトマイズ粉を焼結することによって得られた非晶質体であることを特徴とするスペッタリングターゲットは、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、また、当業者にとって自明のものでもない。

請求の範囲

1. (削除)

2. (補正後) 平均結晶子サイズが 1 nm～5 nm の組織を備え、 Zr, Pt, Pd, Fe, Co, Cu から選択した少なくとも 1 元素を主成分として原子比率で 50 at % 以上含有する 3 元系以上合金からなり、 12 % 以上の原子半径差及び負の混合熱を満たす金属ガラスの要件を備え、 96.4 % 以上の相対密度を有し、 ガスマトマイズ粉を焼結することによって得られた非晶質体であることを特徴とするスパッタリングターゲット。

3. (補正後) 平均結晶子サイズが 1 nm～2 nm の組織を備えていることを特徴とする請求の範囲第 2 項記載のスパッタリングターゲット。

4. (削除)

5. (削除)

6. (削除)

7. (補正後) Zr を主成分とする 3 元系以上の合金であり、 さらに Cu, Ni, Al から選択した少なくとも 1 種以上の元素を含有することを特徴とする請求の範囲第 2 項又は第 3 項に記載のスパッタリングターゲット。

8. (補正後) Pt を主成分とする 3 元系以上の合金であり、 さらに Pd, Cu, P から選択した少なくとも 1 種以上の元素を含有することを特徴とする請求の範囲第 2 項又は第 3 項に記載のスパッタリングターゲット。

9. (補正後) Pd を主成分とする 3 元系以上の合金であり、 さらに Cu, Ni, P から選択した少なくとも 1 種以上の元素を含有することを特徴とする請求の範囲第 2 項又は第 3 項に記載のスパッタリングターゲット。

10. (補正後) Feを主成分とする3元系以上の合金であり、さらにTi, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, Wから選択した少なくとも1成分とBを含有することを特徴とする請求の範囲第2項又は第3項に記載のスパッタリングターゲット。

11. (補正後) Coを主成分とする3元系以上の合金であり、さらにFe, Ta, Bから選択した少なくとも1種以上の元素を含有することを特徴とする請求の範囲第2項又は第3項に記載のスパッタリングターゲット。

12. (補正後) Cuを主成分とする3元系以上の合金であり、さらにZr, Tiから選択した少なくとも1種以上の元素を含有することを特徴とする請求の範囲第2項又は第3項に記載のスパッタリングターゲット。

13. (補正後) ガスマトマイズ粉を焼結することによって製造することを特徴とする請求の範囲第2項、第3項又は第7項～第12項のいずれかに記載のスパッタリングターゲットの製造方法。